

## 期刊信息

篇名	用DC-PCVD装置对钢沉积Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> 薄膜
语种	中文
撰写或编译	
作者	吴大兴, 杨川, 高国庆等
第一作者单位	
刊物名称	金属学报
页面	1997年3月, Vol.33, No.3
出版日期	1997年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">直流等离子体法沉积氮化硅薄膜形成机理及性能研究</a>